

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年4月13日(13.04.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/058698 A1

- (51) 国際特許分類:
C23C 14/34 (2006.01) B21B 3/00 (2006.01)
B21B 1/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/037346
- (22) 国際出願日: 2022年10月5日(05.10.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-165421 2021年10月7日(07.10.2021) JP
- (71) 出願人: 東ソー株式会社 (TOSOH CORPORATION) [JP/JP]; 〒7468501 山口県周南市開成町4560番地 Yamaguchi (JP). 東ソー・スペシャリティマテリアル株式会社 (TOSOH SPECIALITY MATERIALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒9902338 山形県山形市蔵王松ヶ丘2丁目1番6号 Yamagata (JP).
- (72) 発明者: 正能 大起 (SHONO Daiki); 〒2521123 神奈川県綾瀬市早川2743番地1 東ソー株式会社 東京研究センター内 Kanagawa (JP). 近藤 大雅 (KONDO Taiga); 〒2521123 神奈川県綾瀬市早川2743番地1 東ソー株式会社 東京研究センター内 Kanagawa (JP). 召田 雅実 (MESUDA Masami); 〒2521123 神奈川県綾瀬市早川2743番地1 東ソー株式会社 東京研究センター内 Kanagawa (JP). 伊藤 謙一 (ITO

Kenichi); 〒9902338 山形県山形市蔵王松ヶ丘2丁目1-6 東ソー・スペシャリティマテリアル株式会社内 Yamagata (JP). 花輪 浩一 (HANAWA Koichi); 〒9902338 山形県山形市蔵王松ヶ丘2丁目1-6 東ソー・スペシャリティマテリアル株式会社内 Yamagata (JP).

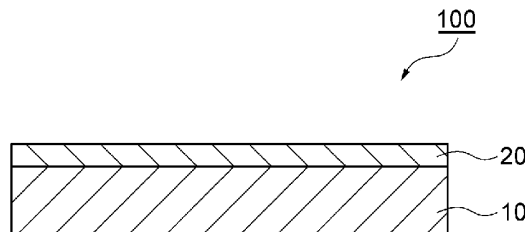
(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,

(54) Title: SPUTTERING TARGET, METHOD FOR PRODUCING SAME, AND METHOD FOR PRODUCING SPUTTERING FILM USING SPUTTERING TARGET

(54) 発明の名称: スパッタリングターゲット、その製造方法、及びスパッタリングターゲットを用いたスパッタリング膜の製造方法



(57) Abstract: This sputtering target contains crystal grains, contains 3 vol% or less of an amorphous phase, and contains at least one metal selected from the group consisting of chromium, molybdenum, and chromium-molybdenum alloys.

(57) 要約: スパッタリングターゲットは、結晶粒子を含み、非晶質相の含有率が3体積%以下であり、クロム、モリブデン、及び、クロム-モリブデン合金からなる群より選ばれる少なくとも1種の金属を含む。

[続葉有]



WO 2023/058698 A1

ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）